

大見研究室 和文 論文リスト

1998 年

- 812(F) 大見忠弘、白井泰雪、池田信一、「特集①:ガス供給系の集積化 特殊ガス供給用小型集積化ガスパネル」、クリーンテクノロジー、Vol.8、No.1、(日本工業出版(株))、pp.1-5、1998 年 1 月。
- 813(M) 大見忠弘、「一巻頭言—21世紀の超LSI生産方式」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.10、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-6、1998 年 2 月。
- 814(P) 河合邦浩、牛木健雄、余謨群、篠原壽邦、森田瑞穂、大見忠弘、「ゲート電極材料のスパッタリング成膜時におけるゲート酸化膜へのダメージの評価」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.97、No.557、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM97-198、pp.87-92、1998 年 2 月。
- 815(P) 大見忠弘、柴田直、小谷光司、中井努、中田明良、余寧梅、譽田正宏、森本達郎、山下雄一郎、「連想するハードウェアをベースとした“しなやかな”知的電子システム」、電子情報通信学会論文誌、Vol.J81-D-I、No.2、((社)電子情報通信学会)、pp.51-61、1998 年 2 月。
- 816(M) 大見忠弘、「特集 LSI・LCD工場の環境対策 Part2●テクノロジー(削減策 1) 代替フロン・ガスのリサイクル技術、環境対策とコスト削減を両立 排ガス中のラジカル処理が決め手、東北大で試用へ」、日経マイクロデバイス、1998 年 3 月号、No.153、(日経 BP 社)、pp.50-55、1998 年 3 月。
- 817(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーン半導体技術と次世代加工プロセス技術」、(社)砥粒加工学会研究会資料平成 10 年度第 1 回研究会「日本における産学官共同研究による最先端技術」、((社)砥粒加工学会)、pp.8-19、1998 年 3 月。
- 818(P) 大見忠弘、白井泰雪、橋本泰司、吉田政司、「金属表面不働態処理が可能にする理想的なガス供給システム」、第 9 回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(住友金属工業(株)、住金ステンレス鋼管(株))、1998 年 3 月。
- 819(P) 白井泰雪、中村修、永瀬正明、大見忠弘、「高純度ガス配管高信頼性溶接技術」、第 9 回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(住友金属工業(株)、住金ステンレス鋼管(株))、1998 年 3 月。
- 820(P) 橋本泰司、白井泰雪、青山博一、大見忠弘、「エッチング反応性ガス使用後の回収リサイクル」、第 48 回 VLSI FORUM「次世代エッチング技術—新材料・地球温暖化対策への対応—、(株)プレスジャーナル)、pp.27-35、1998 年 3 月。
- 821(P) 大見忠弘、「大学からベンチャーは生まれるか?—大学における産官学連携—」、「日本ベンチャー学会」設立シンポジウム、(日本ベンチャー学会)、p.2、1998 年 3 月。
- 822(P) 柴田直、中田明良、譽田正宏、森本達郎、大見忠弘、「連想アーキテクチャに基づく知能電子システムの研究」、平成 9 年度重点領域研究 極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269)、pp.306-316、1998 年 3 月。
- 823(P) 大見忠弘、小谷光司、中田明良、今井誠、森本達郎、平山昌樹、伊野和英、牛木健雄、「プロセス・回路・システム一体化による知能エレクトロニクスの創出」、平成 9 年度重点領域研究 極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269)、pp.354-380、1998 年 3 月。
- 824(F) 小谷光司、今井誠、Ho-Yup Kwon、野沢俊之、藤林正典、大見忠弘、「ビットスライス・フレックスウェア方式データフローパスマニマムプロセッサ」、平成 9 年度重点領域研究極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269)、pp.390-399、1998 年 3 月。
- 825(F) 大見忠弘、今井誠、小谷光司、「知能集積回路—瞬時応答を可能にするビットフロー型データフローパスマニマムプロセッサ」、電子情報通信学会論文誌、C- I、Vol.J81-C- I、No.4、pp.179-186、1998 年 4 月。
電子情報通信学会論文誌、C- II、Vol.J81-C- II、No.4、pp.377-384、1998 年 4 月。

- 826(M) 大見忠弘、「製造装置大口径化CVD装置エッチャ「セミコン関西 98」200mm 対応の半分と画的に小さくなる300mm対応 LSI製造装置」、日経マイクロデバイス、1998年6月号、No.156、(日経BP社)、pp.177-179、1998年6月。
- 827(P) 大見忠弘、「半導体製造用トータルガス供給システム」、第16回大阪酸素/BOC EDWARDS 半導体セミナー講演集、(大阪酸素工業株)、pp.79-89、1998年6月。
- 828(M) 大見忠弘、平山昌樹、海原竜、伊野和英、「極薄シリコン酸化膜研究の課題」、シリコンテクノロジー、No.2、ラジカル酸化の最近の展開特集号、(応用物理学会)、pp.2-5、1998年6月。
- 829(P) 大見忠弘、「次世代AM-LCD製造プロセスの展望」、第8回ファインプロセス テクノロジー・ジャパン'98 セミナー要録、(リード エグジビション ジャパン株)、pp.3-13、1998年7月。
- 830(P) 大見忠弘、新田雄久、「序文 新時代を迎える半導体生産技術」、第32回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1998年7月。
- 831(P) 平山昌樹、海原竜、関根克行、斉藤祐司、大見忠弘、「マイクロ波励起高密度プラズマを用いた薄膜形成技術」、第32回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.20-25、1998年7月。
- 832(P) 大木厚志、木本雅裕、橋本泰司、大見忠弘、「Si系特殊ガスの高感度不純物計測技術」、第32回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.46-53、1998年7月。
- 833(P) 白井泰雪、岸田好晴、大見忠弘、「プロセスガス回収・再利用技術」、第32回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.100-105、1998年7月。
- 834(P) 中島太司、石原良夫、大見忠弘、「次世代半導体工場のための高潔浄乾燥空気製造供給装置」、第32回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.116-123、1998年7月。
- 835(P) 白井泰雪、中村修、大見忠弘、「酸化アルミ不働態膜によるオゾン供給」、第32回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.145-150、1999年7月。
- 836(P) 三好伸二、麻秀吉、福田幸生、中川佳紀、菊山裕久、大見忠弘、「ウルトラクリーンエキシマレーザガス」、第32回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.159-164、1998年7月。
- 837(M) 大見忠弘、「転換期を迎える半導体技術」、カイジョー技報、Vol.4、No.8、(株カイジョー)、pp.2-8、1998年7月。
- 838(M) 大見忠弘、「新技術創出とその実用化に伴う課題ーウルトラクリーンテクノロジーを例としてー」、応用物理、Vol.67、No.8、((社)応用物理学会)、pp.924-925、1998年8月。
- 839(M) 大見忠弘、「一卷頭言ーエキシマリソグラフィにおける環境」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.10、No.4、(半導体基盤技術研究会)、pp.286-291、1998年8月。
- 840(P) 海原竜、平山昌樹、大見忠弘、「高密度プラズマによる高品質シリコン直接酸化技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.98、No.242、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号SDM98-114、pp.1-5、1998年8月。
- 841(P) 関根克行、斉藤祐司、平山昌樹、大見忠弘、「高密度プラズマを用いたシリコン直接窒化膜の低温形成」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.98、No.242、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号98-115、pp.7-11、1998年8月。
- 842(P) 三浦隆治、小野津崇之、久保百司、寺石和夫、宮本明、斉藤祐司、海原竜、関根克行、平山昌樹、大見忠弘、「シリカ表面への希ガス照射過程に関する分子動力的検討」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.98、No.242、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号98-116、pp.13-19、1998年8月。
- 843(P) 大川猛、中村修、大見忠弘、「極薄ゲート酸化膜の有機物汚染が与える影響」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.98、No.243、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号98-124、pp.9-14、1998年8月。

- 844(P) 進藤亘、酒井重史、大見忠弘、「マイクロ波励起高密度プラズマによる低温(300°C)ポリシリコンの成膜」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.98、No.243、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 98-125、pp.15-19、1998年8月。
- 845(P) 金本啓、中田明良、岡マウリシオ正純、玉井幸夫、大見忠弘、「BF₂⁺イオン注入後の低温アニールによる極浅・低リークp⁺n接合形成」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.98、No.243、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 98-126、pp.21-28、1998年8月。
- 846(P) 大嶋一郎、伊野和英、牛木健雄、河合邦浩、大見忠弘、「低抵抗 bcc-Taゲート完全空乏型SOI MOSデバイス作製技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.98、No.243、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 98-129、pp.41-47、1998年8月。
- 847(P) 都賀智仁、新田雄久、三木正博、原田康之、大見忠弘、「ULSI製造対応高性能ウエットクリーンプロセス～パーティクルフリー枚葉式ウエハ洗浄システム～」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.98、No.243、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 98-133、pp.69-75、1998年8月。
- 848(M) 大見忠弘、「インテルの復活」、ANTENNA 東北大学電気情報系の歴史 75th Anniversary、(東北大学電気情報系)、pp.234-239、1998年8月。
- 849(M) 大見忠弘、白井泰雪、「半導体プロセスにおける超高純度ガスの安定供給技術」、高圧ガス、Vol.35、No.9、(高圧ガス保安協会)、pp.20-28、1998年9月。
- 850(P) 平山昌樹、海原竜、関根克行、斉藤祐司、大見忠弘、「高密度マイクロ波プラズマを用いたゲート絶縁膜形成技術」、プラズマ材料科学第153委員会、第40回研究会資料、(日本学術振興会)、pp.9-14、1999年9月。
- 851(B) 大見忠弘、小島泉里、「第18章 電子工業 18・1 概論」、水処理管理便覧、(丸善株)、pp.607-609、1998年9月。
- 852(F) 白井泰雪、岸田好晴、大見忠弘、「PFCの動向と回収装置」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.10、No.5/6、(半導体基盤技術研究会)、pp.364-368、1998年10月。
- 853(F) 三木正博、大見忠弘、「半導体産業における化学資源回生への挑戦」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.10、No.5/6、(半導体基盤技術研究会)、pp.377-384、1998年10月。
- 854(M) 大見忠弘、「—未来科学技術共同研究センター—未来情報社会創製」、青葉工業会報第42号、(東北大学工学部青葉工業会)、pp.13-15、1998年10月。
- 855(M) 平山昌樹、大見忠弘、「新しい半導体製造装置の構成法＝低コスト・高生産性半導体製造ライン実現を目指して＝」、クリーンテクノロジー、(日本工業出版)、pp.21-30、1998年11月。
- 856(M) 大見忠弘、白井泰雪、「新ウェーハ時代の超高純度ガス供給システム」、セミコンダクターアニュアル／ガス供給編、ガスメディア臨時創刊、((有)ガスメディア)、pp.14-20、1998年11月。
- 857(P) 大見忠弘、「知能の極限集積化」、第2回システムLSI琵琶湖ワークショップ講演資料集およびポスター資料集、((社)電子情報通信学会)、pp.119-135、1998年11月。
- 858(W) 丸尾和幸、柴田直、大見忠弘、「 ν MOSを応用した直線 Hough 変換回路の設計」、第9回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.17-23、1998年11月。
- 859(W) 篠原壽邦、大見忠弘、「コジェネレーションと潜熱蓄熱を用いたエネルギー供給システム」、第9回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.27-29、1998年11月。
- 860(W) 都賀智仁、原田康之、新田雄久、三木正博、大見忠弘、「ULSI 製造対応高性能ウエットクリーンプロセス～パーティクルフリー枚葉式ウエハ洗浄システムの研究開発～」、第9回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.33-42、1998年11月。
- 861(W) 山口隆弘、Mani Soma、石田雅裕、大見忠弘、「VCOテスト:プロセス変動が発振特性に与える影響について」、第9回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.63-69、1998年11月。
- 862(W) 大見 忠弘、「新産業創出に向けて」、第9回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.81-85、1998年11月。

- 863(M) 大見忠弘、「製造コスト削減を実現する最新半導体製造技術」、M&E、Vol.25、No.1、(工業調査会)、pp.102-111、1998年12月。
- 864(M) 大見忠弘、「半導体・液晶ディスプレイ製造における静電気対策」、静電気学会誌、Vol.22、No.6、(静電気学会)、pp.275-276、1998年12月。
- 865(M) 大見忠弘、大川猛、中村修、「有機物汚染がシリコン素子に与える影響」、真空、Vol.41、No.12、(日本真空協会)、pp.1011-1015、1998年12月。